

半導體設備

薄膜沉積工藝- Deposition



磁控濺射镀膜
Sputter



电子束蒸发镀膜
E-Beam Evaporation



有机及热阻蒸发镀膜
Thermal Evaporation



脉冲激光沉积
PLD



分子束外延系统
MBE



离子束沉积
IBD



PECVD



MPCVD



MOCVD



ALD



LPCVD



ICPCVD

刻蝕工藝- Etching



反应离子刻蚀
RIE



电感耦合等离子体刻蚀机
ICP



离子束刻蚀机
IBE



深硅刻蚀 DEEPSI ETCH



原子层刻蚀 ALE



XeF₂ 二氟化氙气相刻蚀



HF 释放刻蚀

